

Dispositivo De Purga De Gás Inerte Em Pfa De Alta Pureza Para Análise De Traços De Precursores Semicondutores Sistema De Purga Compatível Com Nitrogênio E Argônio

Número do item: PL-CP429



introdução

Dispositivo de purga de gás inerte de ultra-alta pureza em PFA para detecção e análise de traços de precursores semicondutores. Projetado para purga com nitrogênio ou argônio para evitar oxidação da amostra e contaminação em fluxos de trabalho laboratoriais críticos. Construção durável e resistente a produtos químicos para pesquisa profissional.

[Saiba mais](#)

Aplicação	Descrição	Benefício Principal
Teste de Precursores Semicondutores	Purga de precursores organometálicos com argônio para evitar oxidação antes da análise ICP-MS.	Garante a caracterização precisa de precursores ALD/CVD.
Controle de Qualidade de Fabricação de CI	Purga de gás de alta pureza para análise de metais traço em produtos químicos de processo.	Reduz o limite de detecção eliminando a contaminação baseada em materiais.
Pesquisa de Eletrólitos de Baterias	Protegendo componentes de baterias de lítio sensíveis à umidade durante a extração de solvente e purga.	Mantém a estabilidade do eletrólito para testes eletroquímicos consistentes.
Síntese de Catalisadores	Gerenciando catalisadores sensíveis ao ar durante a transição de síntese para análise.	Previne o envenenamento do catalisador por oxigênio atmosférico ou umidade.
Análise de Traços Petroquímicos	Removendo frações voláteis de matrizes de hidrocarbonetos complexas usando deslocamento de nitrogênio.	Excelente resistência a compostos agressivos contendo enxofre e solventes.
Preparação de Nanomateriais Avançados	Mantendo um ambiente inerte durante o preparo da amostra de nanopartículas funcionalizadas.	Preserva a química da superfície e evita oxidação superficial não intencional.
Análise de Gases Especiais	Servindo como uma interface de alta pureza para amostragem e análise de gases eletrônicos de alta pureza.	Previne ruído de fundo de vazamentos atmosféricos ou degaseificação de materiais.

Recurso	Detalhes da Especificação (PL-CP429)
PFA de Ultra-Alta Pureza (Perfluoroalquilo)	
Processo de Fabricação	Usinagem CNC de Precisão / Fabricação Personalizada
Capacidade Padrão	30ml (Tamanhos personalizados disponíveis sob solicitação)
Compatibilidade com Gás	Nitrogênio (N2), Argônio (Ar), Hélio (He) e outros gases inertes
Resistência Química	Resistência a todos os solventes comuns, ácidos fortes e bases
Faixa de Temperatura	Totalmente personalizável com base nos requisitos de temperatura da aplicação específica
Classificação de Pressão	Design otimizado para pressões padrão de purga de gás (Personalizável)

Aplicação	Descrição	Benefício Principal
Recurso	Detalhes da Especificação (PL-CP429)	
Portas de Conexão	Adaptadas para se ajustar às linhas de gás existentes e interfaces de instrumentos analíticos	
Protocolo de Limpeza	Compatível com lavagem ácida e procedimentos de limpeza de alta pureza	